

# 四楕円鏡型浮遊帯域溶融装置

型式：FZ-T-12000-X-VIII-VPO-PC



**Crystal Systems Corp.**

**株式会社クリスタルシステム**

〒408-0044 山梨県北杜市小淵沢町 9633 番地 1

TEL 0551-36-5271 FAX:0551-36-5273

<http://www.crystalsys.co.jp> e-mail: [eigyo@crystalsys.co.jp](mailto:eigyo@crystalsys.co.jp)

## 1. 装置仕様書

型式	FZ-T-12000-X-VIII-VPO-PC		
使用ランプ種類	キセノン		
使用ランプ、ミラー個数	4 (個)		
最高到達圧力	0.95 (MPa)		
最高到達真空度	$5 \times 10^{-5}$ (Torr) ( $6.7 \times 10^{-3}$ Pa)		
シャフト部シール方式	O リングシール		
最高到達温度	3,000 (°C)		
常用使用温度	2,800 (°C)		
標準具備ランプ (ランプは 4 本一組)	3,000 (W)		
円周方向温度差	50 (°C以下)		
ランプ冷却方式	空冷		
ミラー冷却方式	空冷		
石英管シール冷却方式	水冷		
シャフト/ミラーステージ	上下シャフト移動 / ミラーステージ固定		
下シャフト移動長(結晶育成長)	150 (mm)		
上シャフト移動長(原料棒供給長)	150 (mm)		
最大原料棒長	150 (mm)		
下シャフト(結晶育成)速度遅送り (上下シャフト連動機能付)	0.01~300 (mm/hr)		
下シャフト移動速度早送り	6~150 (mm/min)		
上シャフト移動速度遅送り	0.01~300 (mm/hr)		
上シャフト移動速度早送り	6~150 (mm/min)		
上下シャフト回転速度	5~100 (rpm)		
溶融域観察方式	CCD カメラ		
雰囲気ガス流量制御	フロート式フローメーター : ①Ar 5 (L/min) ②O <sub>2</sub> 500 (cc/min) ③Air 10 (L/min) (Compressor 付)		
ランプ出力制御方式	プログラム式出力調整 (4 本を一括制御)		
出力安定度	入力変動±10 (%)に対して±0.4 (%)以下		
用力	電力	三相 200 (V), 100 (A)	
	冷却水	5 (L/min)	
装置寸法 (mm)	本体	制御盤(ガス BOX 含む)	キセノン電源
	幅	1,020	800
	奥行	760	700
	高さ	2,200	1,800

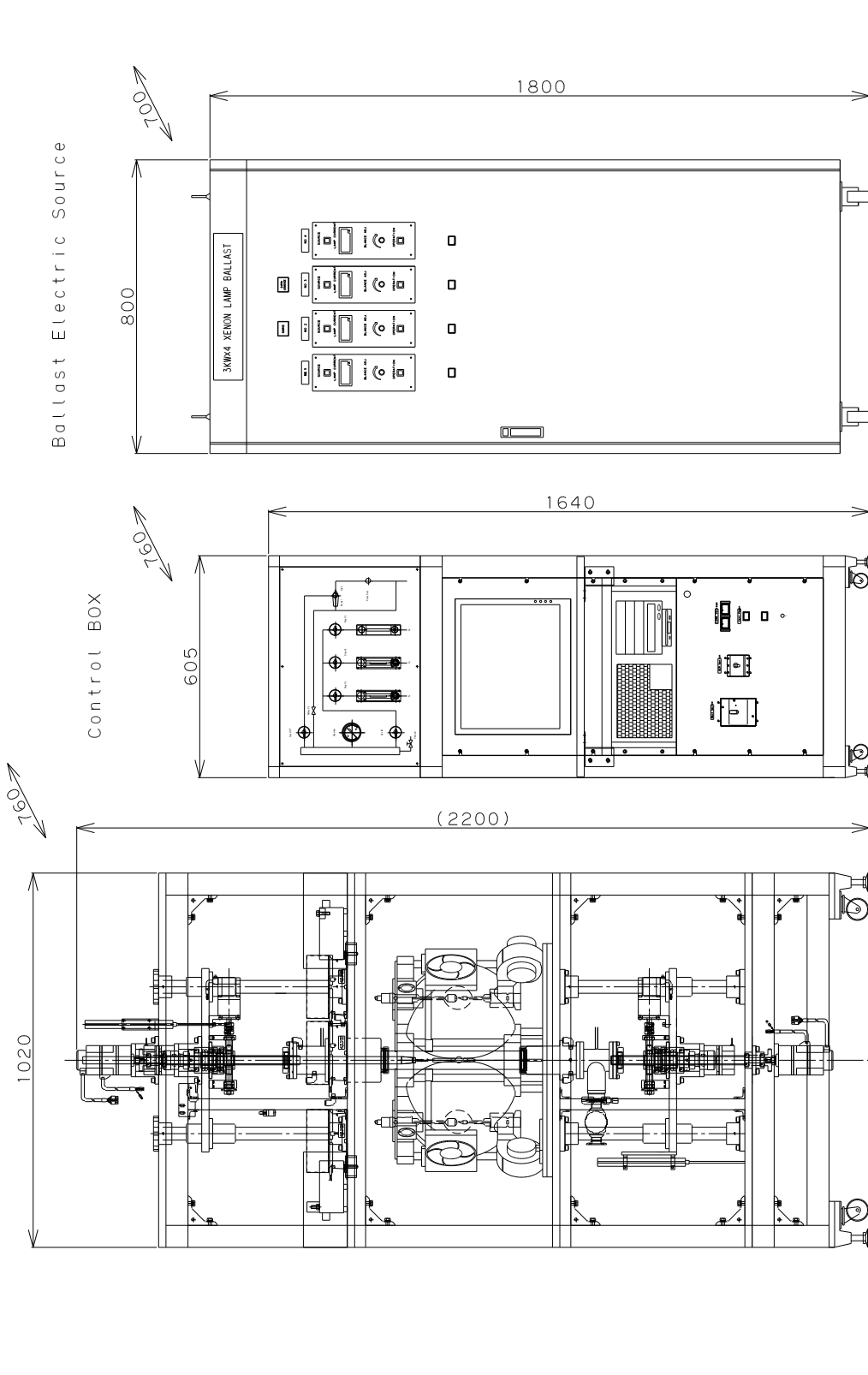
注) 上記仕様は断り無く変更することがあります。 随時、営業担当者にお問い合わせ下さい。

## 2. 標準付属品

- 1) キセノンランプ 最高出力 3,000(W) . . . . . 8 (本)
- 2) 石英管 (標準管) . . . . . 2 (本)  
(高圧管) . . . . . 2 (本)
- 3) Oリング、バックアップリング (石英管シール) . . . . . 2 (セット)  
(シャフトシール) . . . . . 2 (セット)
- 4) 種子結晶保持治具 . . . . . 2 (個)
- 5) 原料棒保持治具 . . . . . 2 (個)
- 6) 工具箱 . . . . . 1 (箱)

### 3. 参考図

FZ Furnace  
 FZ-T-12000-X-VII-VPO-PC  
 3φ 200V、100A



Unit:mm

#### 4. 配置图

